ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Bureau international



DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets 7:

C23C 16/04, 16/50, H01J 37/32

(11) Numéro de publication internationale:

WO 00/66804

(43) Date de publication internationale: 9 novembre 2000 (09.11.00)

(21) Numéro de la demande internationale:

PCT/FR00/00916

A1

(22) Date de dépôt international:

11 avril 2000 (11.04.00)

(30) Données relatives à la priorité:

99/06178

29 avril 1999 (29.04.99)

FR

(71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): SIDEL ACTIS SERVICES [FR/FR]; Avenue de la Patrouille de France, Octeville-sur-Mer, B.P. 204, F-76053 Le Havre Cedex (FR).

(72) Inventeur; et

(75) Inventeur/Déposant (US seulement): CHOLLET, Patrick [FR/FR]; Sidel, B.P. 204, F-76053 Le Havre Cedex (FR).

(74) Mandataire: PUTET, Gilles; Sidel, Sce Propriété Industrielle, B.P. 204, F-76053 Le Havre Cedex (FR). (81) Etats désignés: AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW, brevet ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée

Avec rapport de recherche internationale.

(54) Title: DEVICE FOR TREATING A CONTAINER WITH MICROWAVE PLASMA

(54) Titre: DISPOSITIF POUR LE TRAITEMENT D'UN RECIPIENT PAR PLASMA MICRO-ONDES

(57) Abstract

The invention concerns a device for treating with microwave plasma a container, characterised in that the container is placed in a chamber (12) made of a conductive material and is rotationally symmetrical, and the device comprises a wave guide tunnel (15) substantially perpendicular to the axis (A1) of the chamber and which emerges therein in the form of a rectangular window whereof the smaller dimension corresponds to its dimension along the chamber axis, and the internal diameter of the chamber (12) is such that the microwaves are propagated in the chamber mainly according to a mode whereby the electric field resulting from the propagation of the microwaves exhibit an axial rotational symmetry.

(57) Abrégé

L'invention propose un dispositif pour traitement par plasma micro-ondes d'un récipient, caractérisé en ce que le récipient est placé dans une enceinte (12) en matériau conducteur qui est cylindrique de révolution, en ce que le dispositif comporte un tunnel guide d'onde (15) qui est sensiblement perpendiculaire à l'axe (A1) de l'enceinte et qui débouche dans celle-ci sous la forme d'une fenêtre rectangulaire dont la plus petite dimension correspond à sa dimension selon la direction de l'axe de l'enceinte, et en ce que le diamètre interne de l'enceinte (12) est tel que les micro-ondes se propagent dans l'enceinte principalement selon un mode dans lequel

le champ électrique résultant de la propagation des micro-ondes présente une symétrie axiale de révolution.

UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AL	Albanic	ES	Espagne	LS	Lesotho	SI	Slovénie
AM	Arménie	FI	Finlande	LT	Lituanie	SK	Slovaquie
AΤ	Autriche	FR	France	LU	Luxembourg	SN	Sénégal
AU	Australie	GA	Gabon	LV	Lettonie	SZ	Swaziland
AZ	Azerbaīdjan	GB	Royaume-Uni	MC	Monaco	TD	Tchad
BA	Bosnie-Herzégovine	GE	Géorgie	MD	République de Moldova	TG	Togo
BB	Barbade	GH	Ghana	MG	Madagascar	TJ	Tadjikistan
BE	Belgique	GN	Guinée	MK	Ex-République yougoslave	TM	Turkménistan
BF	Burkina Faso	GR	Grèce		de Macédoine	TR	Turquie
BG	Bulgarie	HU	Hongrie	ML	Mali	TT	Trinité-et-Tobago
ВJ	Bénin -	ΙE	Irlande	MN	Mongolie	UA	Ukraine
BR	Brésil	IL	Israēl	MR	Mauritanie	UG	Ouganda
BY	Bélarus	IS	Islande	MW	Malawi	US	Etats-Unis d'Amérique
CA	Canada	IT	Italie	MX	Mexique	UZ	Ouzbékistan
CF	République centrafricaine	JP	Japon	NE	Niger	VN	Viet Nam
CG	Congo	KE	Kenya	NL	Pays-Bas	YU	Yougoslavie
CH	Suisse	KG	Kirghizistan	NO	Norvège	zw	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	République populaire	NZ	Nouvelle-Zélande		
СМ	Cameroun		démocratique de Corée	PL	Pologne		
CN	Chine	KR	République de Corée	PT	Portugal		
CU	Cuba	KZ	Kazakstan	RO	Roumanie		
CZ	République tchèque	LC	Sainte-Lucie	RU	Fédération de Russie		
DE	Allemagne	LI	Liechtenstein	SD	Soudan		
DK	Danemark	LK	Sri Lanka	SE	Suède		
EE	Estonie	LR	Libéria	SG	Singapour		

WO 00/66804 PCT/FR00/00916

Dispositif pour le traitement d'un récipient par plasma micro-ondes

L'invention se rapporte au domaine des procédés de traitement de surfaces sur un récipient, par exemple en matériau thermoplastique.

L'invention trouvera par exemple application dans le domaine du dépôt de couches minces à effet barrière sur des bouteilles ou des pots en matériaux thermoplastiques tels que le polyéthylène téréphtalate.

En effet, on cherche actuellement à améliorer les propriétés barrières de ces récipients, notamment en vue de diminuer leur perméabilité aux gaz ou d'augmenter leur opacité à certains rayonnements, notamment les ultraviolets, ceci afin d'augmenter la durée de conservation des produits emballés dans ces récipients.

10

15

20

25

30

35

Dans ce but, divers procédés ont été proposés qui visent soit à modifier directement le matériau du récipient, au moins en surface, soit à recouvrir les récipients d'une couche de matériau organique ou inorganique permettant d'améliorer les propriétés du récipient. Pour réaliser de tels traitements, une voie particulièrement intéressante consiste à effectuer un traitement par plasma à basse pression. Dans un tel procédé, on crée à l'intérieur de l'enceinte un vide en même temps que l'on y injecte un fluide réactionnel sous une pression absolue de préférence inférieure à 1 mbar. Le fluide réactionnel varie en fonction de la nature du matériau que l'on souhaite déposer. Il comporte un précurseur du matériau à déposer, généralement sous la forme d'un gaz ou d'un mélange de gaz. Il peut aussi comporter un gaz porteur.

Ce fluide réactionnel est soumis à un ravonnement électromagnétique de type micro-ondes propre à exciter le précurseur pour former un plasma qui crée des molécules actives. Dans le cas d'un traitement de dépôt, ces molécules peuvent se déposer sur la surface du récipient par le biais d'une liaison physico-chimique particulièrement forte qui garantit la stabilité du matériau déposé. Toutefois, dans certains cas. le traitement peut consister en une simple modification de la surface du matériau constitutif du récipient. Il n'y alors pas de dépôt d'une nouvelle couche de matière mais modification du matériau du récipient par interaction avec les molécules ou espèces actives du plasma.

L'utilisation de rayonnements électromagnétiques de type microondes permet notamment d'obtenir des dépôts ayant une structure particulière impossible à obtenir avec d'autres rayonnements tels que les rayonnements de type radiofréquences qui sont largement utilisés.

5

10

15

20

25

30

35

Une des difficultés que l'on rencontre dans la mise en œuvre de ces procédés réside dans le fait d'obtenir une uniformité du traitement sur toute la surface à revêtir. Dans le cas d'un traitement de dépôt, ces problèmes d'homogénéité peuvent avoir des répercussions en termes d'épaisseur de la couche déposée et en termes de composition de cette couche. Bien entendu, cette mauvaise homogénéité de la couche déposée n'est pas satisfaisante.

Or, l'obtention d'un traitement homogène passe notamment par l'utilisation d'un plasma présentant la plus grande uniformité possible.

L'invention a donc pour but de proposer un dispositif permettant d'obtenir une propagation optimale des micro-ondes apte à garantir une bonne homogénéité du plasma. Pour les traitements de dépôt, ce dispositif doit de plus permettre que cette homogénéité soit obtenue tout en utilisant des temps de traitement compatibles avec une utilisation industrielle, c'est-à-dire avec des vitesses de dépôt relativement importantes.

Dans ce but, l'invention propose un dispositif pour le traitement de surface d'un récipient, du type dans lequel le traitement est réalisé à l'aide d'un plasma à basse pression par excitation d'un fluide réactif grâce à des ondes électromagnétiques de type micro-ondes, et du type dans lequel le récipient est placé dans une enceinte en matériau conducteur à l'intérieur de laquelle les micro-ondes sont introduites par l'intermédiaire d'un dispositif de couplage, caractérisé en ce que l'enceinte est cylindrique de révolution autour d'un axe principal du récipient, en ce que le dispositif de couplage comporte un tunnel guide d'onde qui s'étend selon une direction sensiblement perpendiculaire à l'axe de l'enceinte et qui débouche dans une paroi latérale de celle-ci sous la forme d'une fenêtre qui, en projection sur un plan tangent à l'enceinte, présente une forme rectangulaire dont la plus petite dimension correspond à sa dimension selon la direction de l'axe de l'enceinte, et en ce que le diamètre interne de l'enceinte est tel que les micro-ondes se propagent dans l'enceinte principalement selon un mode dans lequel le champ électrique résultant de la propagation des microondes présente une symétrie axiale de révolution.

10

15

20

25

30

35

Selon d'autres caractéristiques de l'invention :

- lorsque les micro-ondes sont introduites dans l'enceinte en l'absence de récipient, la variation de l'intensité du champ électrique présente deux maxima sur un rayon de l'enceinte;
- les micro-ondes ont une fréquence de 2,45 GHz, et le diamètre interne de l'enceinte est compris entre 213 et 217 mm ;
- lorsque les micro-ondes sont introduites dans l'enceinte en l'absence de récipient, la variation de l'intensité du champ électrique présente trois maxima sur un rayon de l'enceinte ;
- les micro-ondes ont une fréquence de 2,45 GHz, et le diamètre interne de l'enceinte est compris entre 334 et 340 mm ;
- lorsque les micro-ondes sont introduites dans l'enceinte en l'absence de récipient, la variation de l'intensité du champ électrique présente quatre maxima sur un rayon de l'enceinte;
- les micro-ondes ont une fréquence de 2,45 GHz, et le diamètre interne de l'enceinte est compris entre 455 et 465 mm;
 - le tunnel guide d'onde est de section rectangulaire :
- les micro-ondes ont une fréquence de 2,45 GHz, en ce que la section du tunnel guide d'onde présente des dimensions d'environ 43 mm selon la direction de l'axe de l'enceinte et d'environ 86 mm selon la direction perpendiculaire;
- le fluide réactif est introduit à l'intérieur du récipient de manière que le traitement s'effectue sur la face interne du récipient ;
- le fluide réactif est introduit dans l'enceinte, à l'extérieur du récipient, de manière que le traitement s'effectue sur la face externe du récipient;
 - à l'intérieur de l'enceinte, une cavité est délimitée par une paroi réalisée en un matériau qui est sensiblement transparent aux micro-ondes, et le récipient est reçu à l'intérieure de la cavité; et
- le traitement comprend une étape de dépôt d'un matériau par plasma basse pression.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description détaillée qui suit ainsi que dans le dessin annexé dans lequel la figure unique illustre de manière schématique un dispositif conforme aux enseignements de l'invention.

WO 00/66804

15

20

25

Le dispositif illustré schématiquement sur la figure unique est un poste de traitement 10 conforme aux enseignements de l'invention. Il est plus particulièrement destiné à assurer la mise en œuvre d'un procédé de dépôt par plasma à basse pression d'un revêtement sur la face interne d'un récipient en matériau thermoplastique.

A titre d'exemple, le récipient peut être une bouteille en polyéthylène téréphtalate (PET) et le revêtement à former peut être constitué d'un matériau à base de carbone. Toutefois, l'invention pourra avantageusement être mise en œuvre pour d'autres récipients et pour d'autres types de revêtements, par exemple pour des revêtements à base d'oxydes de silicium ou d'oxydes aluminium. Tous ces revêtements sont en effet particulièrement intéressants car ils permettent de diminuer de manière importante la perméabilité d'une bouteille en PET vis-à-vis de gaz tels que l'oxygène et le dioxyde de carbone.

Le poste de traitement 10 est prévu pour traiter une bouteille à la fois. Toutefois, ce poste sera de préférence intégré à une machine rotative comportant une série de postes identiques, ceci afin de pouvoir traiter un grand nombre de bouteilles dans un temps donné.

Le poste 10 comporte donc une enceinte extérieure 12 en matériau conducteur, par exemple métallique. L'enceinte 12 est cylindrique d'axe A1 et, selon l'invention, elle est dimensionnée pour favoriser un mode particulier de couplage d'un champ électromagnétique de type microondes.

En effet, le poste 10 comporte un générateur 14 qui est agencé à l'extérieur de l'enceinte 12 et qui est susceptible de délivrer un champ électromagnétique dans le domaine des micro-ondes. La fréquence du champ de micro-ondes délivré par le générateur 14 est par exemple de 2,45 GHz.

Le générateur 14 est monté dans un coffret 13 à l'extérieur de l'enceinte 12, et le rayonnement électromagnétique qu'il délivre est amené jusqu'à l'enceinte 12 par un guide d'ondes 15 en forme de tunnel qui s'étend selon un rayon de l'enceinte cylindrique et qui débouche au travers d'une fenêtre aménagée dans l'enceinte, sensiblement à mi-hauteur de celle-ci.

Comme cela sera divulgué en détails plus bas, la forme et les dimensions du guide d'ondes 15 sont elles aussi adaptées pour permettre un couplage favorable du champ de micro-ondes dans l'enceinte 12.

A l'intérieur de l'enceinte 12, on a disposé un tube 16 qui est coaxial à l'enceinte, qui est sensiblement transparent pour les micro-ondes, et qui délimite, à l'intérieur de l'enceinte 12, une cavité cylindrique 18 coaxiale à l'enceinte 12. Le tube 16 est par exemple réalisé en quartz. La cavité 18 est fermée à l'une de ses extrémités axiales, en l'occurrence l'extrémité inférieure, par une paroi transversale inférieure 26 de l'enceinte 12. Au contraire, l'extrémité supérieure de la cavité 18 est ouverte pour permettre l'introduction d'une bouteille à l'intérieur de la cavité dans laquelle elle va subir un traitement. La bouteille est disposée de manière sensiblement coaxiale à l'enceinte 12 et à la cavité 18.

Un couvercle 20 est destiné à refermer de manière étanche l'extrémité supérieure de la cavité 18 de telle sorte que l'on puisse y faire le vide. Pour permettre l'introduction du récipient 24 à l'intérieur de la cavité 18, le couvercle 20 est mobile axialement.

15

20

25

30

35

Sur le couvercle 20, il est prévu des moyens 22 pour maintenir le récipient 24 par le col, et des moyens pour créer différents niveaux de vide dans la cavité 18. Ainsi, dans le cas du traitement de la surface interne du récipient, on crée dans le récipient 24 un vide correspondant à une pression absolue d'environ 0,1 mbar, et, à l'extérieur de la bouteille, on crée un vide correspondant à une pression absolue d'environ 50 mbar. Le vide créé autour du récipient 24 évite que celui-ci ne soit soumis à un trop grand différentiel de pression qui conduirait à une déformation du récipient. Toutefois, ce vide n'est pas suffisamment poussé pour permettre la formation d'un plasma, ceci afin que l'énergie apportée par les microondes ne soit pas dispersée à l'extérieur de la bouteille où on ne souhaite pas réaliser de dépôt. Un autre mode de fonctionnement est de créer, autour du récipient 24, un vide suffisamment bas, par exemple inférieur à 0,01 mbar, pour que le plasma ne puisse s'y amorcer. Ce mode de fonctionnement est techniquement moins intéressant car il faut plus de temps pour atteindre ce bas niveau de pression.

Bien entendu, le couvercle 20 comporte aussi des moyens pour injecter dans l'enceinte, en l'occurrence à l'intérieur du récipient 24, un fluide réactionnel qui contient au moins un précurseur pour le matériau que

l'on souhaite déposer sur la paroi interne du récipient. On notera que le traitement du récipient 24 pourra aussi comporter la mise en œuvre de procédés complémentaires au procédé de dépôt. On peut ainsi envisager d'effectuer un premier procédé de préparation de la surface du récipient avant d'effectuer le dépôt, ou d'effectuer un procédé ultérieur au dépôt.

Le dispositif comporte aussi des plateaux annulaires 28, 30 d'axe A1 qui sont disposés dans l'enceinte 12, autour du tube de quartz 16. Les deux plateaux 28, 30 sont décalés axialement l'un par rapport à l'autre de manière à être agencés axialement de part et d'autre de la fenêtre par laquelle le guide d'onde 15 débouche dans l'enceinte 12. Toutefois, leurs positions axiales respectives peuvent varier en fonction de la forme du récipient 24 à traiter. En effet, les plateaux 28, 30, qui sont réalisés en matériau conducteur de l'électricité, sont destinés à former des courts-circuits pour le champ électromagnétique introduit dans l'enceinte 12, ceci de manière à confiner axialement le champ pour avoir un maximum de l'intensité au niveau de la zone effective de traitement. Les plateaux 28, 30 sont donc portés par des tiges 32, 34 coulissantes axialement qui permettent un réglage rapide et aisé de la position axiale des plateaux.

10

15

20

25

35

Selon l'invention, le dispositif proposé doit permettre l'obtention, à l'intérieur de l'enceinte, d'un plasma présentant la plus grande homogénéité possible. Pour ce faire, il faut que l'intensité du champ électromagnétique soit répartie de la manière la plus uniforme possible, et notamment que l'intensité du champ en un point de l'enceinte soit sensiblement indépendante de la position axiale du point considéré, mais aussi sensiblement indépendante de la position angulaire de ce point autour de l'axe A1.

Pour ce faire, il est apparu que les meilleurs résultats ont été obtenus avec le poste de traitement tel que défini ci-dessous.

Le guide d'onde 15, dont on a vu qu'il s'étend selon un rayon par rapport à l'axe A1, est délimité radialement vers l'extérieur par une paroi de fond 36 agencée sensiblement à 185 mm de l'axe A1. Le guide d'onde 15 présente une section rectangulaire constante dont la hauteur selon la direction de l'axe A1 est d'environ 43 mm et dont la largeur est d'environ 86 mm.

Le générateur 14 est disposé de telle sorte que son antenne 38, qui pénètre dans le guide d'onde 15 par une ouverture aménagée dans une

paroi inférieure du guide d'onde, soit située radialement par rapport à la paroi de fond 36 à la distance prédéterminée préconisée par le constructeur du générateur.

Toutefois, pour obtenir une répartition optimum de l'intensité du champ électromagnétique, il est apparu que le paramètre déterminant était le diamètre interne de l'enceinte 12.

En effet, dans le cadre de l'utilisation d'un générateur de microondes à 2,45 GHz, des résultats particulièrement probants ont été obtenus pour les dans les trois cas suivants :

- le diamètre interne de l'enceinte est compris entre 213 et 217 mm, auquel cas, en l'absence de récipient et de vide dans la cavité, la variation de l'intensité du champ électrique présente deux maxima sur un rayon de l'enceinte :

10

20

- le diamètre interne de l'enceinte est compris entre 334 et 340 mm, auquel cas, en l'absence de récipient et de vide dans la cavité, la variation de l'intensité du champ électrique présente trois maxima sur un rayon de l'enceinte :
- le diamètre interne de l'enceinte est compris entre 455 et 465 mm, auquel cas, en l'absence de récipient et de vide dans la cavité, la variation de l'intensité du champ électrique présente quatre maxima sur un rayon de l'enceinte.

Ces résultats sont susceptibles d'être mis en évidence en disposant, à l'intérieur de l'enceinte, des feuilles de papier thermosensible selon diverses orientations (radiales, circonférentielles et transversales) pour obtenir une image du champ électromagnétique régnant dans l'enceinte. Dans les trois cas, on a pu remarquer que le champ électromagnétique présentait une symétrie axiale de révolution autour de l'axe A1.

Dans le cas d'une enceinte présentant un diamètre interne d'environ 215 mm, on pourra par exemple utiliser un tube de quartz 16 présentant un diamètre interne d'environ 85 mm. Avec un tel dispositif, des essais ont permis de déposer, sur la face interne d'une bouteille en PET d'un volume de 500 ml, un revêtement homogène d'un matériau à base de carbone avec des vitesses moyennes de dépôt de l'ordre de 300 à 400 angströms par seconde. Ainsi, le temps de traitement permettant d'obtenir une couche barrière efficace est de l'ordre de 1 à 3 secondes, ce qui permet de mettre en œuvre ce dispositif à échelle industrielle.

De la sorte, l'invention permet d'aboutir à un dispositif industriel pour effectuer sur la paroi interne du récipient un dépôt présentant toutes les qualités requises, notamment en termes de propriétés barrières, dans un temps très court. De plus, ce dispositif est suffisamment simple et compact pour pouvoir être installé sur une machine tournante capable de traiter un nombre important de récipients par heure.

Par ailleurs, un tel dispositif peut être utilisé pour effectuer d'autres types de traitements que les dépôts de revêtements, par exemple des traitements mettant en jeu un gaz ou un mélange de gaz tel que l'oxygène, l'azote ou l'argon qui ne provoquent pas de dépôt de matière mais qui, portés à l'état de plasma, modifient en surface la structure du matériau constitutif du récipient. Il peut aussi être utilisé pour traiter la surface externe du récipient. Dans ce cas, il faudra bien entendu que le fluide réactif soit injecté dans la cavité mais à l'extérieur du récipient.

10

20

25

30

REVENDICATIONS

1. Dispositif pour le traitement de surface d'un récipient, du type dans lequel le traitement est réalisé à l'aide d'un plasma à basse pression par excitation d'un fluide réactif grâce à des ondes électromagnétiques de type micro-ondes, et du type dans lequel le récipient est placé dans une enceinte (12) en matériau conducteur à l'intérieur de laquelle les micro-ondes sont introduites par l'intermédiaire d'un dispositif de couplage,

caractérisé en ce que l'enceinte (12) est cylindrique de révolution autour d'un axe principal (A1) du récipient (24), en ce que le dispositif de couplage comporte un tunnel guide d'onde (15) qui s'étend selon une direction sensiblement perpendiculaire à l'axe (A1) de l'enceinte et qui débouche dans une paroi latérale de celle-ci sous la forme d'une fenêtre qui, en projection sur un plan tangent à l'enceinte, présente une forme rectangulaire dont la plus petite dimension correspond à sa dimension selon la direction de l'axe de l'enceinte, et en ce que le diamètre interne de l'enceinte (12) est tel que les micro-ondes se propagent dans l'enceinte principalement selon un mode dans lequel le champ électrique résultant de la propagation des micro-ondes présente une symétrie axiale de révolution.

- 2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que, lorsque les micro-ondes sont introduites dans l'enceinte (12) en l'absence de récipient (24), la variation de l'intensité du champ électrique présente deux maxima sur un rayon de l'enceinte.
- 3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que les micro-ondes ont une fréquence de 2,45 GHz, et en ce que le diamètre interne de l'enceinte (12) est compris entre 213 et 217 mm.
- 4. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que lorsque les micro-ondes sont introduites dans l'enceinte en l'absence de récipient, la variation de l'intensité du champ électrique présente trois maxima sur un rayon de l'enceinte.

- 5. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en ce que les micro-ondes ont une fréquence de 2,45 GHz, et en ce que le diamètre interne de l'enceinte (12) est compris entre 334 et 340 mm.
- 6. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que lorsque les micro-ondes sont introduites dans l'enceinte en l'absence de récipient, la variation de l'intensité du champ électrique présente quatre maxima sur un rayon de l'enceinte.
- 7. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en ce que les micro-ondes ont une fréquence de 2,45 GHz, et en ce que le diamètre interne de l'enceinte est compris entre 455 et 465 mm.
- 8. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, 15 caractérisé en ce que le tunnel guide d'onde (15) est de section rectangulaire.
 - 9. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en ce que les micro-ondes ont une fréquence de 2,45 GHz, en ce que la section du tunnel guide d'onde (15) présente des dimensions d'environ 43 mm selon la direction de l'axe (A1) de l'enceinte (12) et d'environ 86 mm selon la direction perpendiculaire.

25

30

- 10. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le fluide réactif est introduit à l'intérieur du récipient (24) de manière que le traitement s'effectue sur la face interne du récipient.
- 11. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le fluide réactif est introduit dans l'enceinte (12), à l'extérieur du récipient (24), de manière que le traitement s'effectue sur la face externe du récipient.
- 12. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que, à l'intérieur de l'enceinte (12), une cavité (18) est délimitée par une paroi (16) réalisée en un matériau qui est

WO 00/66804 PCT/FR00/00916

11

sensiblement transparent aux micro-ondes, et en ce que le récipient (24) est reçu à l'intérieure de la cavité (18).

13. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le traitement comprend une étape de dépôt d'un matériau par plasma basse pression.

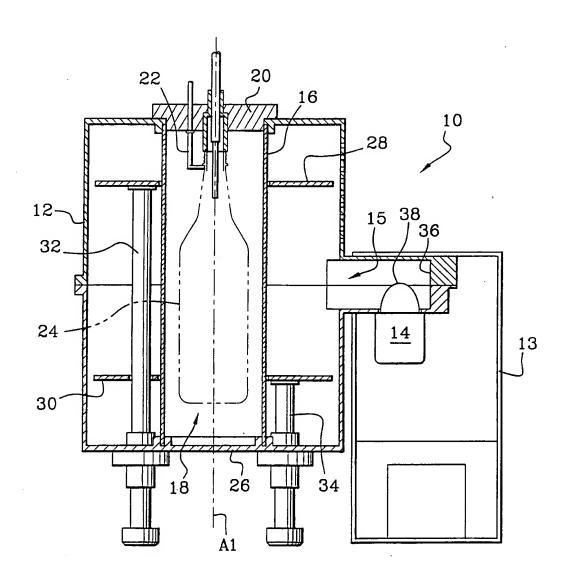


FIG. UNIQUE

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

inte onal Application No PCT/FR 00/00916

A. CLASS IPC 7	ification of subject matter C23C16/04 C23C16/50 H01J37/	′32		
According t	o International Patent Classification (IPC) or to both national classifi	ication and IPC		
	SEARCHED			
	ccumentation searched (classification system followed by classification can be considered by classification system followed by classification system for the context of	tion symbols)		
	tion searched other than minimum documentation to the extent that			
	ata base consulted during the international search (name of data b	ase and, where practical, search terms used)		
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category 3	Citation of document, with indication, where appropriate, of the re	evant passages	Relevant to claim No.	
A	WO 99 17334 A (LAURENT JACQUES ; LAVAL HOLDINGS & FINANCE (CH)) 8 April 1999 (1999-04-08) page 5, line 6 -page 7, line 18;	<u> </u>	1-13	
A	EP 0 881 197 A (LEYBOLD SYSTEMS 2 December 1998 (1998-12-02) column 4, line 41 -column 5, linfigure 1		1-13	
A	EP 0 346 168 A (CENTRE NAT RECH 13 December 1989 (1989-12-13) column 3, line 43 - line 59; fig		1-13	
Furth	er documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in	annex.	
"A" documer conside "E" earlier do filing da "L" documer which is citation	nt which may throw goubts on priority claim(s) or sided to establish the publication date of another or other special reason (as specified) at referring to an oral disclosure, use, exhibition or	T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention. *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone. *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled.		
	nt published prior to the international filling date but in the priority date claimed	"&" document member of the same patent fa	mily	
Date of the ad	ctual completion of the international search	Date of mailing of the international searce	ch report	
3	July 2000	11/07/2000		
Name and ma	alling address of the ISA Suropean Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016	Authonzed officer Patterson, A		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

...formation on patent family members

PCT/FR 00/00916

				member(s)	Publication date	
WO 9917334	Α	08-04-1999	AU	9180598 A	23-04-1999	
EP 0881197	A	02-12-1998	DE CN JP	19722205 A 1200381 A 10330945 A	03-12-1998 02-12-1998 15-12-1998	
EP 0346168	A	13-12-1989	FR DE DE ES WO JP US	2631199 A 68911390 D 68911390 T 2049339 T 8911206 A 3504301 T 5063330 A	10-11-1989 27-01-1994 07-07-1994 16-04-1994 16-11-1989 19-09-1991 05-11-1991	

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Den • Internationale No PCT/FR 00/00916

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE CIB 7 C23C16/04 C23C16 C23C16/50 H01J37/32 Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou a la fois selon la classification nationale et la CIB B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE Documentation minimale consultee (systeme de classification suivi des symboles de classement) CIB 7 C23C H01J Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure ou ces documents refévent des domaines sur lesquets a porte la recherche Base de données electronique consultee au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés) EPO-Internal, PAJ C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS Identification des documents cites, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents no, des revendications visées Catégore 5 Α WO 99 17334 A (LAURENT JACQUES ; TETRA 1-13 LAVAL HOLDINGS & FINANCE (CH)) 8 avril 1999 (1999-04-08) page 5, ligne 6 -page 7, ligne 18; figure EP 0 881 197 A (LEYBOLD SYSTEMS GMBH) Α 1-13 2 décembre 1998 (1998-12-02) colonne 4, ligne 41 -colonne 5, ligne 38; figure 1 EP 0 346 168 A (CENTRE NAT RECH SCIENT) Α 1-13 13 décembre 1989 (1989-12-13) colonne 3, ligne 43 - ligne 59; figures Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe ^a Categories speciales de documents cites: "T" document ulterieur publié après la date de dépôt international ou la date de pnonte et n'appartenenant pas a l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe "A" document définissant l'état general de la technique, non considéré comme particulierement pertinent ou la theone constituant la base de l'invention "E" document anténeur, mais publié à la date de dépôt international "X" document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut ou apres cette date étre considère comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément document pouvant jeter un doute sur une revendication de pnonté ou cité pour déterminer la date de publication d'une 'Y" document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) ne peut etre considerée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associe a un ou plusieurs autres "O" document se reférant a une divulgation orale, la un usage, a une exposition ou tous autres moyens documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du metre document publié avant la date de dépôt international, mais posteneurement à la date de prionté revendiquée *& * document qui fait partie de la même famille de brevets Date d'expedition du present rapport de recherche internationale Date a laquelle la recherche internationale a ete effectivement achevee 11/07/2000 3 juillet 2000 Nom et agresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Fonctionnaire autorise Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentiaan 2 Nt. - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo ni. Fax: (+31-70) 340-3016 Patterson. A

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs a... membres de familles de brevets

PCT/FR 00/00916

Document brevet au rapport de reche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)		Date de publication	
WO 9917334	Α	08-04-1999	AU	9180598 A	23-04-1999	
EP 0881197	Α	02-12-1998	DE CN JP	19722205 A 1200381 A 10330945 A	03-12-1998 02-12-1998 15-12-1998	
EP 0346168	A	13-12-1989	FR DE DE ES WO JP US	2631199 A 68911390 D 68911390 T 2049339 T 8911206 A 3504301 T 5063330 A	10-11-1989 27-01-1994 07-07-1994 16-04-1994 16-11-1989 19-09-1991 05-11-1991	